

界面ナノ電子化学研究会は半導体ウェットプロセスに関する様々な企業、研究機関および大学関係者により、半導体製造プロセスの学術的な解明、発展への貢献を重ねてきました。おかげさまで、今年で設立20周年を迎えることとなりました。本研究会のさらなる発展を目指し、活発な議論、関係者の交流、若手技術者の育成などを目的として、この度、合宿形式の「界面ナノ電子化学研究会フォーラム (INEF2026)」を開催する運びとなりました。"歩みを力に、今を誇りに、未来を創る"というテーマを掲げ、著名な方々より興味深い講演を聴講し、様々な年代、幅広い職種の関係者が2日間にわたり学び、交流し、議論する場を提供します。

## 「歩みを力に、今を誇りに、未来を創る」

# INEF2026

- 主催： 公益社団法人応用物理学会 界面ナノ電子化学研究会(INE)
- 日時： 2026年6月19日(金)12:45~20日(土)12:00
- 場所： 琵琶湖グランドホテル・京近江  
〒520-0101 滋賀県大津市雄琴6-5-1  
《交通》「JR京都駅」より、湖西線「おごと温泉駅」まで約20分  
「おごと温泉駅」より徒歩20分 (シャトルバス準備予定)



### ■プログラム(予定)：

#### 1日目 (6月19日 金曜日)

- ・12:45~13:00 オープニング
- ・13:00~13:50 招待講演①「界面ナノ電子化学研究会 誕生から成長、そして未来へ」  
荒木浩之 様 (SCREENホールディングス)
- ・13:50~14:40 招待講演②「物理博士卒から企業の研究所へ、そして大学へ — 私の歩んだ30年」  
為近恵美 先生 (横浜国立大学)
- ・14:50~17:35 第10回ポスター発表展 (ライトニングトーク含む)
- ・18:30~20:30 第41回カサロス(懇親会) & ランプセッション (ウェットプロセスの未来を語り合う(仮))

#### 2日目 (6月20日 土曜日)

- ・9:00~9:50 招待講演③「ナノ空間界面が支配する分子輸送とバイオ分子計測」  
山本晃毅 様 (理化学研究所)
- ・9:50~10:40 招待講演④「界面流体の新たな計測・制御・理解に向けて」  
元祐昌廣 先生 (東京理科大学)
- ・10:50~11:40 招待講演⑤「界面ナノプロセスの極限性能評価を拓く超精密表面計測」  
有馬健太 先生 (大阪大学)
- ・11:40~12:00 クロージング

- 申込締切： **5月14日(木曜日)**

- 参加費：

区分	本日~4月24日まで	4月25日~5月14日まで
応物会員	¥40,000	¥44,000
一般会員	¥42,000	¥46,000
学生	¥12,000	¥15,000

※参加費、宿泊費(相部屋となります)、懇親会費を含みます

※キャンセル料は5月14日以降100%発生します

- 定員： 先着80名

- 申込： イベントペイよりお申し込みください(クレジットカード払いのみ)

<[https://eventpay.jp/event\\_info?shop\\_code=0672069005389223&EventCode=C928179008](https://eventpay.jp/event_info?shop_code=0672069005389223&EventCode=C928179008)>

## ポスター発表展 同時開催



イベントペイQRコード

\*\*\*\*\*

問合せ先： 西尾賢哉 (ソニーセミコンダクタソリューションズ) [Kenya.Nishio@sony.com](mailto:Kenya.Nishio@sony.com)

大南樹生 (関東化学) [ominami-tatsuki@kanto.co.jp](mailto:ominami-tatsuki@kanto.co.jp)

\*\*\*\*\*

タイトル	発表者	所属
1 IPAマランゴニ乾燥時の帯電現象の把握	杉浦 浩太	愛知工業大学
2 二流体スプレー洗浄時におけるSi/SiO <sub>2</sub> ウェハの表面状態と帯電に関する調査	佐藤 純大	愛知工業大学
3 CMP後洗浄におけるPVAブラシの摩耗に伴う物理的特性変化と洗浄性能の検討	漆原 夏子	株式会社荏原製作所
4 超微細気泡含有の過飽和溶存ガス水の特性評価とその洗浄効果	日高 義晴	大阪公立大学
5 超純水中の微量金属モニタリング技術の開発とSi基板表面の金属汚染挙動解析	益子 征景	オルガノ株式会社
6 高アスペクト構造に対応したMoリセスエッチング液の開発	加賀谷 大成	関東化学株式会社
7 機能水による銅表面制御を用いたハイブリッドボンディングの性能向上	信澤 輝	栗田工業株式会社
8 半導体ウェーハ表面洗浄時における液置換挙動の電極を用いた解析	安達 拓馬	群馬大学
9 半導体ウェーハ裏面洗浄時における液置換挙動の電極を用いた解析	櫻井 涼斗	群馬大学
10 半導体プロセス薬液に対するポリグリセリンの添加効果	杉田 圭	阪本薬品工業株式会社
11 枚葉式洗浄における回転円盤上の液体置換に関する数値計算	美和 誠人	静岡大学
12 次世代半導体デバイスに向けたパーティクル除去技術	中村 優斗	株式会社SCREENセミコンダクタソリューションズ
13 パターン付きウェーハへの回転塗布後のレジスト膜表面の凹凸形成メカニズムの解明	鹿浜 康寛	ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
14 IGZOのWetエッチングにおける表面モフォロジー解析	大島 和樹	ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
15 New Surface Preparation System Batch-Single Hybrid Equipment	森本 大貴	東京エレクトロン九州株式会社
16 ベベルカット精度向上に向けた取組	前田 遼太郎	東京エレクトロン九州株式会社
17 シリコンエッチングへの酸化剤の影響	人見 達矢	株式会社トクヤマ
18 標準粒子を用いたろ過性能の予測	守田 峻海	日本インテグリス合同会社
19 Fusion of Chemical and Physical Cleaning: Launch and Optimization of Chemical Nano spray Process	杉本 優心	マイクロメモリジャパン株式会社
20 Enhanced Particle Detachment Using Chemical-Mechanical Cleaning	Muhammad Atiqqullah Bin Ahmad Zaidi	マイクロメモリジャパン株式会社
21 選択エッチング液	奈良 友貴	三菱ケミカル株式会社
22 ウェットプロセスによるGaNエピタキシャル膜エッチング評価	矢田 恭平	三菱電機株式会社
23 発泡薬液洗浄可能なノズル式超音波洗浄機と真空乾燥実験	山本 義治	ヤマトテクノス有限会社
24 Å世代に向けたRu系配線の信頼性評価および研磨・保護膜形成プロセス開発	眞谷 宗汰	横浜国立大学